



磁控溅射设备

文献类型: 专利

作者 贺凡;刘壮;张军;冯叶

发表日期 2012-04-28

专利国别 中国

专利号 CN201220193104.5

专利类型 实用新型

权利人 中国科学院深圳先进技术研究院

公开日期 2012-12-12

授权日期 2012-12-12

源URL [<http://ir.siat.ac.cn:8080/handle/172644/269>]

专题 深圳先进技术研究院_先进院专利

推荐引用方式 贺凡,刘壮,张军,等. 磁控溅射设备. CN201220193104.5. 2012-04-28.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [深圳先进技术研究院](#)

浏览	下载	收藏
14	2	0

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

